

■ **APIT R & D SA**, à Sion, développement de technologies et d'équipement basés sur la technique des plasmas atmosphériques, société anonyme (FOSC no 29 du 13.02.2003, p. 15, publ. 861058). Modification des statuts: 16. 10. 2003. Nouveau capital-actions libéré: CHF 100'000.--.
Journal no 1542 du 03.11.2003
(01250546 / CH-660.0.860.995-3)